

# 知的財産保護官民合同訪中代表団（ハイレベルミッション）の結果概要

平成 17 年 6 月 23 日  
国際知的財産保護フォーラム

## 1. 結果概要

6 月 12 日から 16 日にかけて、代表団が知的財産関連中央省庁 10 機関を訪問した。結果概要は、以下の通り。

### . 総論

#### (1) 取締強化等への協力

模倣品・海賊版の取締り強化支援をはじめ、当方から提案した協力事項が中国側に受け入れられ、今後の実施に向けてハイレベルでの合意が得られた。

#### (2) 法制度改正等の要請

最優先要請事項であった「デザイン模倣の保護強化」について、法改正案を示しつつ要請をしたところ、日本側の要請内容を真剣に検討していくことが表明された。

また、法改正の発表や重大な知財保護の行動を行うときには、関連資料・情報を日本側に提供することが約束された。

商務部では、「日本側提案を、呉儀副総理、薄熙来部長に必ず報告する」旨の約束がなされた。

### . 各論

#### 1. 取締強化等への協力

模倣品の見分け方（真贋判定）や、商標権侵害となるか否かの判断基準などについての事例集の提供やそれを使ったセミナーの開催、過去に他国で知的財産侵害品を取引した者の情報（ブラックリスト）、著作権者情報の提供等を通じ、日中で知的財産侵害品対策強化に向けて協力をしていくことで合意した。

#### 2. 要請

##### (1) デザイン模倣対策の強化

2007 年改正予定の反不正競争法について、形態模倣規制追加を、法改正の担当官庁である国務院法制弁公室、国家工商行政管理総局、及び影響力がある最高人民法院に改正案を手交して要請した。

先方からは、日本側の要請内容を真剣に検討することが表明された。

将来の意匠法改正時に、外国での公然実施を新規性阻害要因とすること（これにより、すでに外国で使われているデザインについて、中国で他人が勝手に意匠権を取れないこととする）を要請した。

## ( 2 ) 執行の強化

執行の強化策として、取締機関同士で連携を取ること、刑事罰の対象となる場合には、積極的に刑事訴追することなどを要請した。

特にインターネット上の権利侵害について、中国側でも急ピッチで対策を講じていることが表明された。

## ( 3 ) 再犯防止の強化

再犯対策として、罰金や量刑の強化、製造装置の廃棄などの付帯措置の強化などを要請した。

商務部から、日本製品の模倣品だけでなく、中国有名製品の侵害も多く、自国の利益の観点からも、再犯対策強化をしなければならないとの考えが示された。

## ( 4 ) 特許審査遅延分野に対する審査促進

特許審査の迅速化については、着実に実現されているものの、特定の分野に関しては、審査の遅延が発生しており、この分野に対する審査促進を要請した。

これに対し、出願の増加に対して、審査官の大量採用や、ペーパーレス化などの取り組みをしている旨説明があった。

## ( 5 ) 周知商標等による保護

内外無差別による判断の上、日本の企業の有名商標が中国の「馳名商標（周知商標）」に認定されるよう要請した。

## ( 6 ) 水際における権利者負担の軽減

担保金の低額化及び、倉庫保管料、廃棄量の低減、国庫・権利侵害者による負担を要請した。

担保金については、銀行保証でも可能とし、担保金額の基準を明確化するなどの改善を行った旨表明された。

一方、権利侵害品の倉庫保管料については、民事上の問題であり、まず権利者が負担するという現行条例を変える考えがないとの説明であったため、当方から、「知財侵害であることが確定した場合には、権利侵害品の倉庫保管料を侵害者の負担とすることを法律で定めるよう」求めた。

## ( 7 ) 植物新品種保護制度の拡充とその運用改善

今年から新たに農業部と国家林業局にも訪問し、植物新品種の育成者権の強化のため、保護対象植物の拡大などの制度拡充、制度運用や育成者権行使の環境整備、及び海関保護条例に育成者権の追加を要請した。これらの要請に対し、中国政府が積極的に取り組む旨が表明されるとともに、日

中間で情報交換、技術交流等を更に推進していくことが合意された。

## 2. 今後の方針

### (1) 今回のミッションのフォローアップ

要請した事項について、中国側の対応をフォローアップしていく。

協力を約束した事項について、着実に実施する。

次回に向け、日本企業の模倣被害に係るニーズを調査し、それを踏まえ中国の知財法制度をリサーチし、必要な改善提案（法改正要請等）をまとめる。

### (2) 来年以降のミッション実施

現在、参加者に対しアンケートを実施しており、今後、関係省庁、民間関係団体等と検討していく。

## 3. 日程、場所

6月12日（日）～6月16日（木）：北京

## 4. 訪問先

商務部（知財保護対策総合調整）、国务院法制弁公室（法案調整・提出）、国家知識産権局（特許法、意匠法）、国家工商行政管理総局（商標法、不正競争防止法）、国家版權局（著作権法）、農業部（種苗法）、国家林業局（種苗法）、海関総署（税関）、公安部（警察）、最高人民法院（司法、法解釈通達、法改正に意見） 計 10 機関

## 5. メンバー

### (企業参加者)

団 長	宗国 旨英	国際知的財産保護フォーラム 座長 (本田技研工業株式会社 特別顧問)
副団長	渡辺 修	独立行政法人日本貿易振興機構 理事長
副団長	田中 宰	松下電器産業株式会社 代表取締役副社長
副団長	佐藤 修	社団法人日本レコード協会 会長 (株式会社ポニーキャニオン 代表取締役社長)
副団長	高橋 英夫	株式会社サカタのタネ 代表取締役社長
	津田 小亮	住友化学(上海)有限公司社長(総経理)
	加藤 泰助	日本知的財産協会 副理事長 (株式会社東芝 知的財産部長)

### (政府参加者)

政府側代表	奥田 真弥	経済産業省 製造産業局 次長
	小島 康壽	内閣官房知的財産戦略推進事務局 次長
	岩田 悟志	経済産業省 大臣官房審議官(商務情報政策局担当)

澁谷 隆 特許庁総務部長  
吉田 雅彦 経済産業省 大臣官房参事官(模倣品対策・通商担当)  
古井 俊之 財務省関税局 業務課長  
池原 充洋 文化庁 国際課長  
越智 浩 警察庁 知的財産権保護対策官

以上